

УСТАНОВКА ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ «КРАУДИОН-ИПО-11/2»

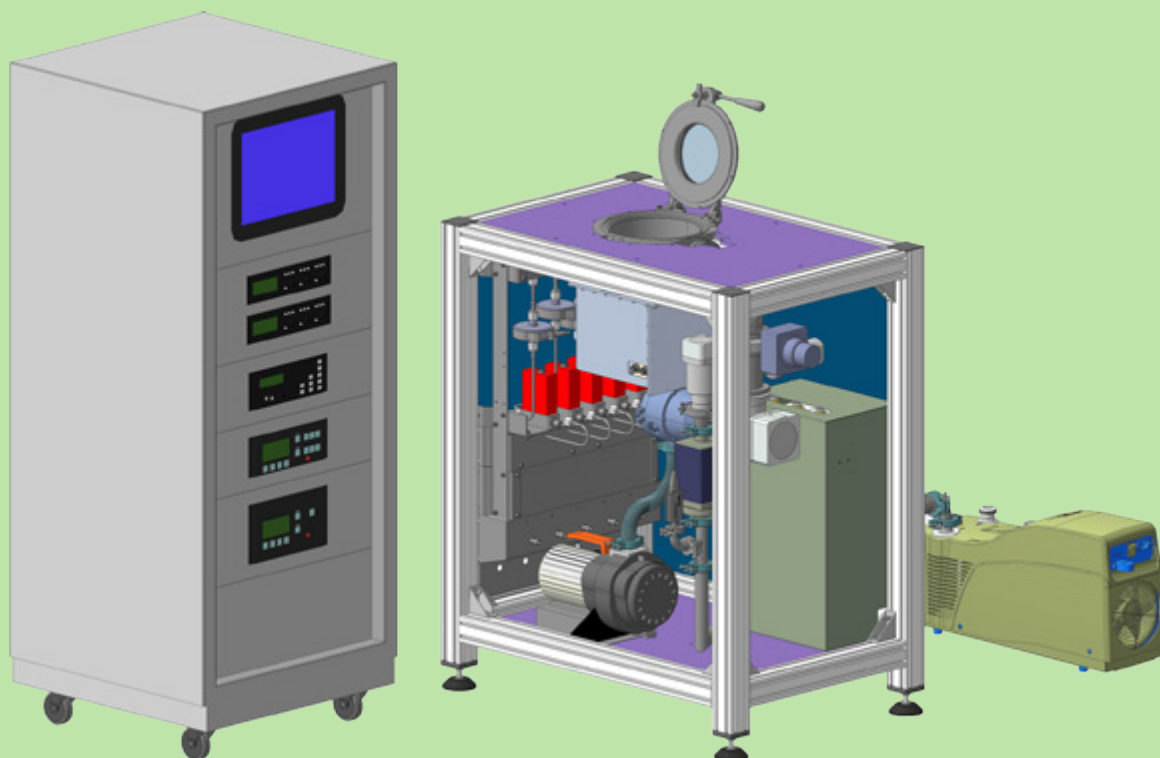
Установка «КРАУДИОН-ИПО-11/2» предназначена для ионно-плазменной обработки наружных поверхностей и внутренних каналов корпусов из ситалла, применяемых в производстве ЭВП.

Установка «КРАУДИОН-ИПО-11/2» обеспечивает проведение следующих технологических операций:

- загрузка изделия в камеру ионно-плазменной обработки;
- безмасляная высоковакуумная откачка вакуумной технологической камеры;
- напуск технологического газа/смеси газов;
- инициирование плазменного разряда и проведение технологического процесса ионно-плазменной обработки наружных поверхностей/внутренних каналов изделия в инертных газах и их смесях с кислородом;
- разгерметизация камеры с напуском инертного газа и выгрузка изделия.

Технологическую систему установки составляют:

- устройство ионно-плазменной обработки PMT-150/1-02-RF/1;
- ВЧ генератор (13.56 МГц, 300 Вт) с согласующим устройством и контроллером;
- 5-ти канальная система напуска газов;
- контур стабилизации рабочего давления газа (дрессельная заслонка, емкостной датчик)



Предельное остаточное давление в вакуумной камере, Па (Торр)	$\leq 1.33 \times 10^{-4}$ ($\leq 1 \times 10^{-6}$)
Параметры ВЧ генератора:	
- рабочая частота, МГц	13.56
- выходная мощность, Вт	1+300
Количество каналов напуска газов, штук	5
Рабочее давление, Торр	1+15
Содержание кислорода в газовой смеси, %	≤ 15
Размеры вакуумной камеры, мм	$\varnothing 200 \times h100$
Габаритные размеры установки:	
- вакуумной стойки, мм	800×600×h1085/h1325
- стойки питания и управления, мм	600×600×h1670

